

## 産総研出願特許公開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム (IDEA) からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部 技術移転室にご相談下さい。

イノベーション推進本部 知的財産部 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159  
mail. aist-tlo (@m.aist.go.jp を付けてください)

2011年 5月公開分 (39件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2011-087601	干渉用二重鎖RNA	独立行政法人産業技術総合研究所
2	特開2011-088044	炭化水素油の水素化脱硫触媒	日揮触媒化成株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
3	特開2011-088804	チタンシリコンカーバイドセラミックスの製造方法	日本電熱株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
4	特開2011-089171	複合構造の硬質材料およびその作製方法	住友電気工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
5	特開2011-089813	顕微鏡用生体試料固定装置	国立大学法人 東京大学 独立行政法人産業技術総合研究所
6	特開2011-089814	水質汚染の検出法及び検出用キット	独立行政法人産業技術総合研究所
7	特開2011-090708	対象個数検出装置および対象個数検出方法	独立行政法人産業技術総合研究所
8	特開2011-092204	麹菌蛋白質加水分解酵素の分泌を増大する組換えベクター	ヒゲタ醤油株式会社 千葉県 AGCテクノグラス株式会社 キッコーマン株式会社 財団法人野田産業科学研究所 独立行政法人産業技術総合研究所
9	特開2011-092821	海洋生物の付着を抑制する方法およびシステム、および、海洋生物の遊泳を阻害する方法	中国電力株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
10	特開2011-093743	ペロブスカイト構造を有するタンタル(V)系酸窒化物含有粉体及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
11	特開2011-093784	シリカ膜およびその形成方法、並びにシリカ被膜付き材料およびその製造方法	株式会社エーアンドエーマテリアル 独立行政法人産業技術総合研究所
12	特開2011-094471	調光透明窓用部材	独立行政法人産業技術総合研究所
13	特開2011-095531	HLAC特徴量抽出方法、異常検出方法及び装置	独立行政法人産業技術総合研究所
14	特開2011-096372	リチウムイオン二次電池用電極活物質及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2011-096470	全固体リチウムイオン二次電池における負極材および全固体リチウムイオン二次電池の製造方法	日立造船株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
16	特開2011-096617	触媒層を付加したチューブ型電気化学セル及びそれらから構成される電気化学反応システム	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
17	特開2011-096694	モールド除去方法およびモールド除去装置	日本サイエンティフィック株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
18	特開2011-097956	核酸測定用の核酸プローブ	日鉄環境エンジニアリング株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
19	特開2011-098303	アスベストの飛散防止処理法	株式会社ストリートデザイン 独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2011-098321	排ガス処理用触媒、その製造方法および排ガス処理方法	三井金属鉱業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
21	特開2011-098425	人型歩行ロボット用脚	川田工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
22	特開2011-098885	カーボンナノチューブ膜構造体及びカーボンナノチューブマイクロ構造体	独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2011-099140	マグネシウム合金、およびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2011-099511	水素吸蔵合金タンクシステム	高砂熱学工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
25	特開2011-099746	太陽電池セル測定用試料台	共進電機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
26	特開2011-099753	測位装置、及びこれを用いたセンサ情報の統合解析による見守りシステム	IDUR株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2011-099802	軸ぶれ計測方法及び軸ぶれ計測機能を具備した自己校正機能付き角度検出器	独立行政法人産業技術総合研究所
28	特開2011-099804	複合自己校正機能付き角度検出器	独立行政法人産業技術総合研究所
29	特開2011-100625	リチウム二次電池用正極活物質及びその製造方法	株式会社GSユアサ 独立行政法人産業技術総合研究所
30	特開2011-100632	イオンビーム発生装置	独立行政法人産業技術総合研究所
31	特開2011-100879	化合物半導体薄膜及びその製造方法、並びに太陽電池	三菱化学株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
32	特開2011-102402	ポラジン系樹脂組成物及びその製造方法、絶縁被膜及びその形成方法、並びに電子部品	日立化成工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
33	特開2011-103260	非水系二次電池用正極活物質	独立行政法人産業技術総合研究所
34	特開2011-103492	光電変換装置及びその製造方法	三菱重工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
35	WO2009/082020	アミノオキシ基を含有する反応性化合物	株式会社DNAチップ研究所 独立行政法人産業技術総合研究所
36	WO2009/084632	アルミニウムケイ酸塩複合体及び該複合体からなる高性能吸着剤	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
37	WO2009/093384	ポリヌクレオチド及びポリヌクレオチド類似体並びにこれらを用いた遺伝子発現制御方法	独立行政法人産業技術総合研究所
38	WO2009/093604	有機ナノチューブ製造方法および製造装置	独立行政法人産業技術総合研究所
39	WO2009/099138	半導体ウエハの洗浄方法および洗浄装置	株式会社REO研究所 独立行政法人産業技術総合研究所